

サンプル

# 特定企業調査報告書

(株式会社日立ハイテク編 サマリー)

株式会社AIRI

# 1. 会社概要

## ■株式会社日立ハイテクの概要

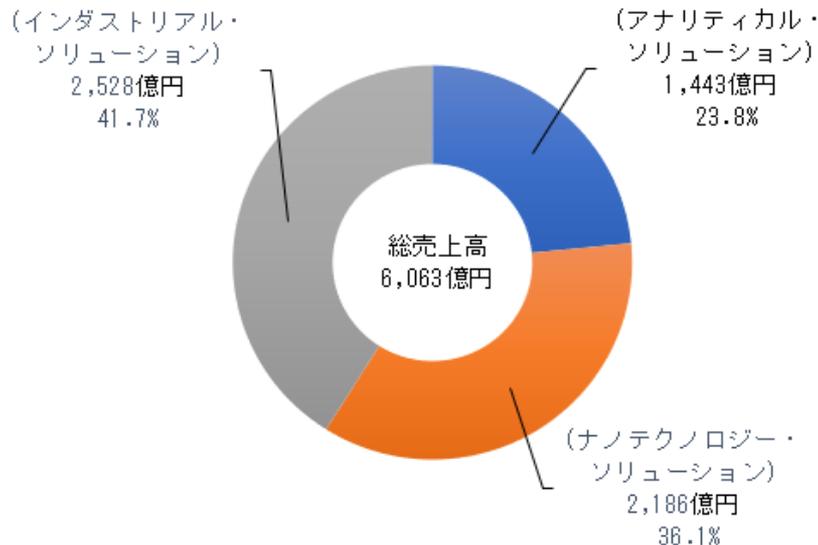
本社所在地	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジネスタワー
設立年月日	1947年4月12日
年間売上高	606,342百万円(2021年3月期;連結)
従業員数	12,276名(2021年3月31日現在;連結)

## ■日立ハイテクグループの業績推移(単位:億円)

	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
総売上高	6,445	6,877	7,311	6,946	6,063
経常利益*	539	556	648	609	552
当期純利益**	402	409	484	436	425

\*: 税引前利益、\*\*: 親会社株主に帰属する当期利益

## ■日立ハイテクグループの事業別の業績(対外部顧客)



# 2. 事業概要

日立ハイテクグループの各事業分野の主な事業内容は以下のとおりです。

株式会社日立ハイテクは、国内12社、海外37社のグループ会社で構成され、ナノテクノロジー・ソリューション、アナリティカル・ソリューション及びインダストリアル・ソリューションに関する事業活動を展開しています。

### (1) ナノテクノロジー・ソリューション

「電子線技術」を集約・強化して、半導体統合ソリューションの提供、新材料・バイオ等の新アプリケーションを創出しています。主要製品は、エッチング装置計測装置・検査装置電子顕微鏡/プローブ顕微鏡

### (2) アナリティカル・ソリューション

「分析技術」をベースに、バイオ・メディカル分野、安全・安心分野等で新たな価値を創造しています。主要製品は、分析装置医用機器ライフサイエンス製品

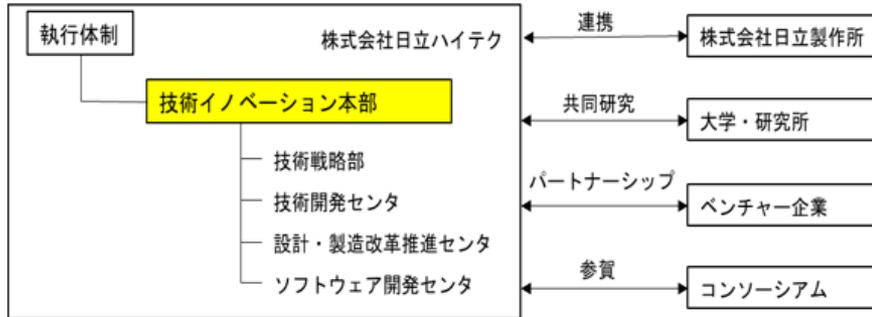
### (3) インダストリアル・ソリューション

ファクトリーオートメーション・IoT・フルバリューチェーンソリューション等のオペレーションテクノロジーを中心としたソリューションによる高付加価値化を実現しています。主要製品は、AI×ICTソリューション産業ソリューション先端産業部材(バリューチェーンソリューション)

### 3. 研究開発情報

「日立ハイテクはFocused Solutions Companyへ」  
 「Focused Solutions」とは、顧客と社会の変化を見据えたソリューションや取り組みを展開していくことで、顧客の最大価値の実現と社会課題の解決に貢献していく、日立ハイテクグループならではの持続的成長に向けた経営方針です。汎用市場の中から個別化・高度化する顧客の課題を把握し、コア・コンピタンスを活かしてその課題にフォーカスした専用装置やサービス、ビジネスモデルといった特化型ソリューションを体系化。それらを提供することで、世界中の顧客から選ばれ続ける企業、社会から必要とされる企業をめざす同社の挑戦でもあります。

日立ハイテクの研究開発体制は以下のとおりです。



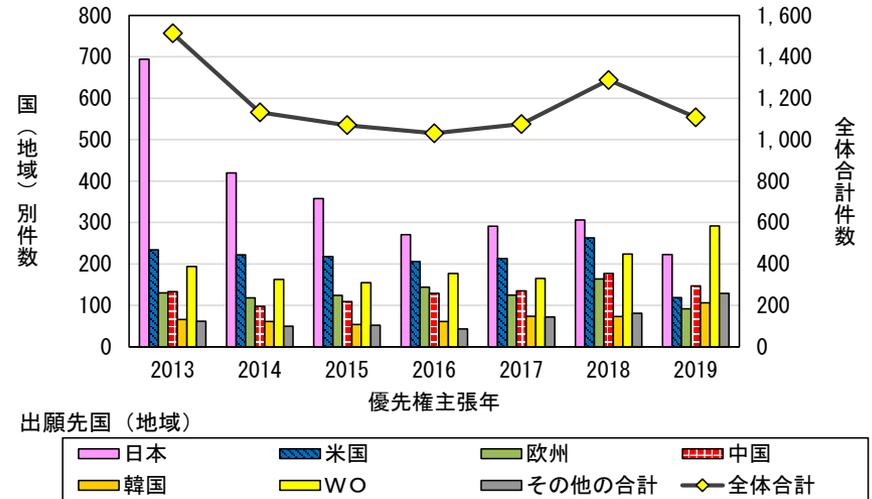
### 4. 知財情報

日立ハイテクグループの知財指標は以下のとおりです。

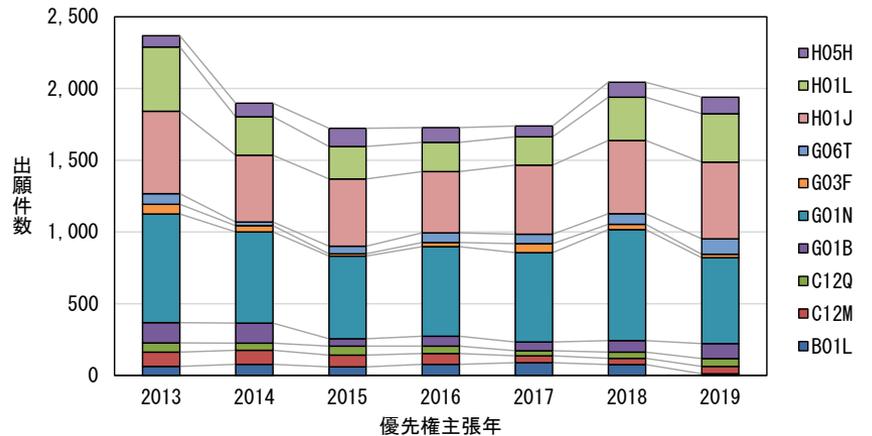
優先権主張年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
出願件数	1,031	1,075	1,288	1,108	440
開発費(百万円)	23,581	26,693	30,797	32,900	30,800
開発費(百万円)/出願	22.9	24.8	23.9	29.7	—

### 5. 各国・地域、IPCサブクラス別の特許出願動向

日立ハイテクグループの各国(地域)への特許出願件数は以下のとおりです。



日立ハイテクグループが出願した特許のIPCサブクラス上位10種の出願件数推移は以下のとおりです。

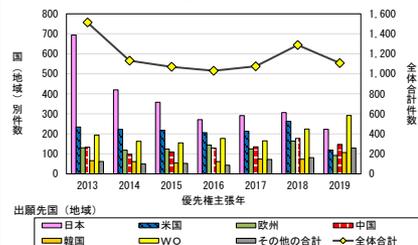


## 6. 競合企業の分析

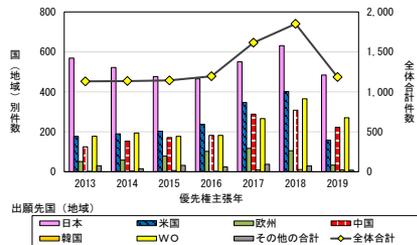
日立ハイテックグループ及び競合他社5者について、日本、米国、欧州、中国、韓国、WO、及びその他を出願先国(地域)として、2013年から2019年までの各年の特許出願件数を調査した結果は以下のとおりです。

注)「その他の合計」とは、日本、米国、欧州、中国、韓国及びWO以外の国(地域)への出願件数の合計

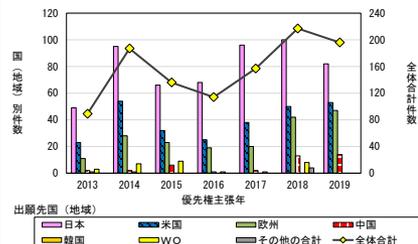
日立ハイテックグループ



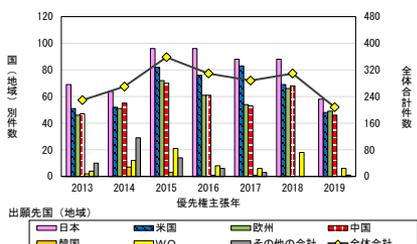
株式会社島津製作所



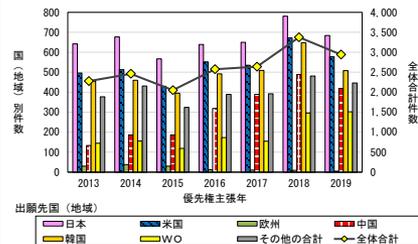
日本電子株式会社



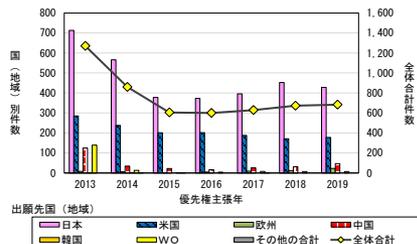
シスメックス株式会社



東京エレクトロン株式会社



キヤノンメディカルシステムズ株式会社

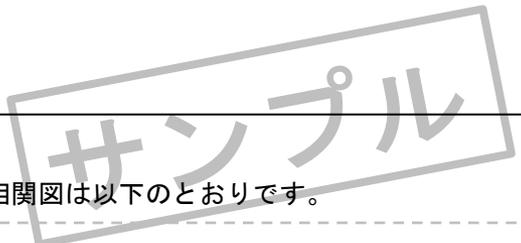


## 7. 注目特許

注目記事「令和3年度全国発明表彰「発明賞」を受賞—「ウェーハ欠陥検出装置の高感度化」が微小欠陥の高感度検出に貢献—」に関連する特許。

出願番号	特願 2009-282445	<p>代表図面</p>
出願日	2009/11/18	
公開番号	特開 2011-106874	
公開日	2011/6/2	
特許番号	特許 5218752	
登録日	2013/3/8	
優先日	-	
発明の名称	欠陥検出方法及び欠陥検出装置並びにこれを備えた欠陥観察装置	
発明者	大谷 祐子, 立崎 武弘, 渡辺 正浩, 松本 俊一	
出願人	株式会社日立ハイテクノロジーズ	
国際特許分類 (IPC)	G01N21/956	
特許出願の技術概要	<p>【課題】本発明の目的は、光学式の欠陥検査装置又は光学式外観検査装置で検出した欠陥をSEMを用いて詳細に観察する場合において、光学式の欠陥検査装置又は光学式外観検査装置で検出した微小欠陥を高感度で検出し、確実にSEMの観察視野内に入れることができ、かつ、装置規模を小さくできる欠陥観察装置を提供することと、ウェハ上の多様な欠陥を高速、高感度に検出する欠陥検出装置および方法、並びにこれを搭載した欠陥観察装置を提供することにある。</p> <p>課題を解決するための手段】被検査物の表面に対して斜方よりレーザを照射する照明光学系と、前記照射されたレーザによる前記被検査物からの散乱光を対物レンズで集光し、固体撮像素子に結像する検出光学系と、を有する欠陥検出装置であって、前記検出光学系は、前記散乱光のうち前記被検査物表面の凹凸による散乱光と前記被検査物表面の異物又は欠陥による散乱光の偏光方向を制御し、透過する偏光方向を選択する分布フィルタを有することを特徴とする欠陥検出装置である。</p>	
パテントファミリー	US3953156B2 US9217718B2 US9759666B2 US10267745B2 WO2011061911A1	
審査経過情報	登録	
訴訟	見出せない	

## 8. 業界相関図



株式会社日立ハイテクを取り巻く業界の相関図は以下のとおりです。

